⑩ 日本国特許庁(JP)

n 特許出願公開

四公開特許公報(A)

- 昭64-86101

@Int_Cl_4

識別記号

厅内整理番号

母公開 昭和64年(1989)3月30日

G 02 B C 08 J

A-8106-2H M-7446-4F

Z-7446-4F審査請求 未請求 請求項の数 1 (全7頁)

反射防止物品の製造方法 69発明の名称

> ②特 願 昭63-137971

②出 願 昭63(1988)6月3日

翌昭62(1987)6月18日每日本(JP)動特願 昭62-151993 優先権主張

⑫発 明 者

滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社滋賀事業

者 谷 ⑫発 明

滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社滋賀事

場内

東レ株式会社 砂出 願

東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号

1. 発明の名称

反射防止物品の製造方法

2. 特許請求の範囲

(1) 基材の表面に、最外表層膜が主として二酸 化ケイ素からなる、少なくとも1層の反射防止膜 を設け、ついで、その表面を、下記一般式(【) で示される有機ケイ素置換基を含む化合物が存在 する環境下で処理することを特徴とする反射防止 物品の製造方法。

R1 R2 a R3 b Si-X3-a-b (ここで、R1、R2、R3は、各々水素、アル キル基、ハロゲン化アルキル基、アリル基、アリ - ル基、ハロゲン化アリール基から選ばれる1種 であり、a、bはそれぞれOまたは1である。X は、加水分解可能な置換基である。)

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、耐汚染性、耐煦傷性、耐加工性など に優れた反射防止物品の製造方法に関するもので ある。

[従来の技術]

従来より反射防止のために、屈折率が基材と異 なる物質を、真空蒸着法などにより基材上に被膜 形成させる方法が行われてきた。この場合反射防 止効果をもっとも高からしめるためには、基材を 被覆する物質の厚みの選択が重要であることが知 られている。このような反射防止膜は、被膜形成 材料が主として無機酸化物あるいは無機ハロゲン 化物であり、プラスチック基材においてはその表 層膜は、二酸化ケイ素が使用されている。

また、特開昭59-49501号公報、特開昭59-50401 号公報には、複層からなる反射防止膜を液 状組成物を用いて形成せしめる方法について記載 されている。この方法においては、最表層膜中に、 シリカ微粒子などに代表される無機物を30重量 %以上含まれることが必要である。

[発明が解決しようとする課題]

しかしながら、蒸贄による方法では、本質的に は高い表面高度を有する反面、水滴が付着し、そ

のまま乾燥した場合、水液中に含まれる無機物が 残溶となって表面にこびり付きとれなくなるとい う欠点を有している。また、水に対する濡れ性が 大きいために雨滴、水の飛沫が付着すると大きく 拡がり、眼鏡レンズなどにおいては大面積にわた って物体がゆがんで見えるなどの問題点があった。

また、特開昭 59-49501号公報などの方法は、表面のすべりが悪く、布などの摩託によって傷がつき易いなどの問題を有している。

また、これらの問題点を改良する目的で各種の表面処理剤が提案され、市販されているが、いずれも水や各種の溶剤によって溶解するために一時的に機能を付与するものであり、永続性がなく耐久性に乏しいものであった。

本発明は、かかる従来技術の欠点を解消しようとするものであり、表面についた無機物などが除去しやすく、かつ撥水性、耐摩耗性を有する反射防止物品の製造方法を提供することを目的とする。 [課題を解決するための手段]

本発明は、上記目的を達成するために下記の構

- 3 -

どによって実験的に定められるべきものである。

これらの反射防止膜の被膜化方法としては、真空蒸着法、イオンプレーティング法、スパッタリング法などに代表される各種のPVD法(Physical Vapor Deposition法)がある。

前記PVD法に適した無機物としては、SiO2以外に、A O2 O3、ZrO2、TiO2、Ta 2 O5、HfO2、SiO、TiO、Ti 2 O3、Yb 2 O3、HgO、CeO2などの無機酸化物が好ましく適用される。

以上のPVD法によって形成される前記反射防止膜の最外表層膜は、主として二酸化ケイ素であることが必要であり、50重量%以上含有されていることが必要である。すなわち、二酸化ケイ素が50重量%未満であると、十分な表面硬度が得られないばかりか、本発明の目的である耐汚染性、耐煦傷性の向上、さらにはこれらの性能の耐久性が顕著に現われない。

また、最外表層膜の膜厚は、反射防止効果以外 の要求性能によってそれぞれ決められるべきもの であるが、とくに反射防止効果を最大限に発揮さ 成を有する。

「基材の表面に、最外表層膜が主として二酸化ケイ素からなる、少なくとも1層の反射防止膜を設け、ついで、その表面を、下記一般式(I)で示される有機ケイ素置換基を含む化合物が存在する環境下で処理することを特徴とする反射防止物品の製造方法。

 $R1R2_aR3_bSi-X_{3-a-b}$ (I) (ここで、R1、 R^2 、 R^3 は、各々水素、アルキル基、ハロゲン化アルキル基、アリル基、アリール基、ハロゲン化アリール基から選ばれる1種であり、a、bはそれぞれりまたは1である。Xは、加水分解可能な置換基である。)」

ここで、反射防止膜としては、少なくとも1層、 すなわち単層または多層からなるものであり、そ の最外表層膜が主として二酸化ケイ素からなり、 最外表層膜より下層を形成する物質としては、二 酸化ケイ素を含めた各種無機物を主成分としてな る。その膜構成は、要求される性能、例えば耐熱 性、反射防止性、反射光色、耐久性、表面硬度な

- 4 -

せる目的には表層膜の光学的膜厚を対象とする光 彼長の¼ないしは、その奇数倍に選択することが 極小の反射率すなわち極大の透過率を与えるとい う点から好ましい。

一方、前記最外表層膜の下層部については特に限定されない。すなわち、表層膜を直接基材上に被膜形成させることも可能であるが、反射防止に効果をより顕著なものとするためには、基材上に最外表層以よりに関いてある。これら複層の反射防止膜の膜がなされている。(光学技術コンタクトVol.9、 No.8、17~23、(1971))。

本発明は、最外表層膜が主として二酸化ケイ素からなる、少なくとも一層の反射防止膜を有する物品を下記一般式(I)で示される置換基を含む有機ケイ紊化合物が存在する環境下で処理するものである。

 $R^1R^2{}_aR^3{}_bSi-X_{3-a-b}$ (I) (ここで、 R^1 、 R^2 、 R^3 は、各々水素、アル

- 6 -

キル基、ハロゲン化アルキル基、アリル基、アリール基、ハロゲン化アリール基から選ばれる1種であり、a、bはそれぞれ0または1である。Xは、加水分解可能な置換基である。)

一般式($\frac{1}{1}$) 中、 $\frac{1}{1}$ 、 $\frac{1}{1}$ 、 $\frac{1}{1}$ 、 $\frac{1}{1}$ 、 $\frac{1}{1}$ は、それぞれ同種であっても、異種であってもよい。

かかる、一般式(I)中のR1R2aR3bSi
ーで示される有機ケイ素 置換基の具体的な代表例
としては、トリメチルシリル、ジメチルシリル、
メチルフェニルシリル、ビニルジメチルシリル、
エチルジメチルシリル、ジェチルメチルシリル、
トリエチルシリル、アリルジメチルシリル、
3-アミノプロピルジメチルシリル
ジエチルシリル、3-アミノプロピルエチル
ジエチルシリル、アミノプロピルエチル
ジエチルシリル、アニールジメチルシリル、ピス(pーピフェニル)メチルシリル、ピフェニルシフェニルシン
フェニルシリル、アーピフェニルシフェニルシリル、アーピフェニルシリル、トリフェニルシンシリル、アーピアエニルシリル、アークロロプロピルジメチルシリル、アークロロプロピルジメチルジメチルシリル、アークロロプロピルジメチルジメチルシリル、アークロロプロピルジメ

とくに、水焼け防止性効果が大きい、さらには、防汚性に優れているなどの点から、トリメチルシリル、ジメチルシリル、 γ-(3,3,3-トリフロロ) プロピルジメチルシリル、フェニルジメチルシリルなどの、有機ケイ素置換基が好ましく使用される。

- 7 -

チルシリル、ヨードメチルジメチルシリル、フロ ロメチルジメチルシリル、アー(3,3,3-トリフロ ロ) プロピルジメチルシリル、アーパーフロロア ルキルプロピルジメチルシリル、n-プロピルジメ チルシリル、i-プロピルジメチルシリル、n-ブチ ルジメチルシリル、sec-ブチルジメチルシリル、 t-プチルジメチルシリル、t-プチルジフェニルシ リル、1-クロロエチルジメチルシリル、2-クロロ エチルジメチルシリル、シクロヘキシルジメチル シリル、ベンジルジメチルシリル、n-オクチルジ メチルシリル、フェニルジメチルシリル、ジフェ ニルメチルシリル、ジフェニルビニルシリル、ジ -n-プロピルメチルシリル、トリ-n- プロピルシ リル、ア-メタクリロキシプロピルジメチルシリ **ル、アーグリシドキシプロピルジメチルシリル、 β-シアノエチルジメチルシリル、アーメルカプ** トプロピルジメチルシリル、β-(3,4-エポキシ シクロヘキシル)エチルジメチルシリル、アーフ ロロピロピルジメチルシリル、ァー(3,3- ジフロ 口〉プロピルジメチルシリルなどが挙げられる。

- 8 -

ェノキシ、ニトロフェノキシなどのアリーロキシ 基、ジメチルケトオキシム、メチルエチルケトオ キシムなどのケトオキシム基、N-メチルカルパメ ート、N-(3- クロロフェニル) カルパメートなど のカルバメート基、ジメチルアミノキシ、ジェチ ルアミノキシなどのジアルキルアミノキシ基、ベ ンジロキシ、フェネチロキシなどのアラルキロキ シ基、フルフリロキシなどのヘテロサイクルアル コキシ基、シクロヘキシロキシなどのシクロアル キロキシ基、メチルビニロキシ基、ウレア、ジフ ェニルウレアなどのウレア基などがその具体例と して挙げられる。なお、Xが、アミノ基、アミド 基、オキシムの一種であるジオキシム基、ジある いはトリアルコキシ基、ウレア基などにおいては、 一般式(])中のR¹R²aR³hSi-で示され る有機ケイ素置換基が一分子内に2個以上含まれ た化合物であっても何ら問題はない。

以上の有機ケイ素化合物は、処理の均一化、取り扱い易さなどの点から沸点が50℃から250℃のものが好ましく使用される。とくに処理後の

キトバなエ、ロアアジ例ミ。 シォメどチベキルルフとド

-3--

操作が簡単で、比較的臭気が少ないことからシラザン化合物、中でもジシラザン化合物、あるいは、アセトアミド化合物、低級アルコキシ化合物がより好ましく適用される。

かかる有機ケイ素化合物は、一種のみならず、 二種以上を併用することも可能であるし、二種以 上を用いて段階的に処理することも可能である。

本発明における前記有機ケイ素置換基含有化合物を含む環境下での処理とは、具体的には、いるには、有機ケイ素置換基含有化合物中への浸渍あるいはそれらの蒸気中への暴露などである。処理時間、処理温度などは目的および基材に応じて決められるであるが、通常処理時間は、1分間から20時間、処理温度は、10℃から100℃の範囲で行われる。

また、前記有機ケイ素置換基含有化合物は、必要に応じて水、アルコール、ケトン、エステル、エーテル、ハロゲン化炭化水素などの溶剤で希釈されていてもよいし、加水分解を促進する目的で酸、アルカリなどが添加されていても何ら問題は

- 11 -

また、ルッキンググラス、CRT用フィルターなどでは、面上の反射した光のために内容物、表示文字などが判然としないという問題が生ずる。

また、前記反射防止物品においては水に対する 静止接触角が60度以上であることが好ましいが、 ここで水に対する静止接触角とは直径2ミリ以下 の水滴を光学物品上に形成させ、その時の接触角 を測定するところの液滴法である。静止接触角が、 60度未満であると充分な撥水性を有しないばか りか、汚れも除きにくい。

本発明における基材は、いなるものでも、 が、透明性、屈折率、分散の光学特性、 には耐熱性、耐熱性、などなどの が、ではでいたが、などなどがあれた。 かなどなどがあれた。 かなどなどがあれた。 かなどなどがあれた。 かなどなどがあれた。 かなどなどがあれた。 かなどの共重には、カーボスート のは、アクリレートの合い。 は、(臭素化)にスフェンを性でして、 アクリレートのウレタン変性モノマーの重合 ない。とくに安全性、揮発性などの点からフッ素 含有有機化合物で希釈したものが好ましく用いら れる。また、芳香を発せしめるためにアルコール、 ケトンなどの溶剤も好ましく使用される。

本発明における有機と含有化へ300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、300年代、30

すなわち、表面反射率が3%を越える場合には、 眼鏡用レンズではゴースト、フレアなどと呼ばれ る反射像を生じて目に不快感を与える場合がある。

- 12 -

よびその共重合体、ポリエステルとくにポリエチ レンテレフタレート、および不飽和ポリエステル、 アクリロニトリルースチレン共重合体、塩化ビニ ル、ポリウレタン、エポキシ樹脂などが好ましい。

さらに本発明においては、かかる基材と反射防止膜との間にハードコートなどの管性、硬度、耐速とも好ましい。被膜になどの間物性を、硬度によって間物性を、できる。 硬色性などの おかには、これらの表面を のためにはして からできる。 できるできるの できるできるの できるできる。 (特公昭50-28449号公報)。 さらには、 アクリル系架権物であってもよい。

本発明における有機ケイ素置換基含有化合物での処理にあたっては、処理されるべき反射防止膜の表面は清浄化されていることが好ましく、清浄化に際しては、界面活性剤による汚れ除去、さらには有機溶剤による脱脂、フレオンによる蒸気洗

- 14 -

浄などが適用される。また、密着性、耐久性の向 上を目的として各種の前処理を施すことも有効な 手段であり、とくに好ましく用いられる方法とし ては活性化ガス処理、酸、アルカリなどによる薬 品処理などが挙げられる。

本発明によって得られる反射防止物品は、通常 の反射防止膜より汚れが取れ易い、撥水性を有し ているので水滴が落ちやすい、水焼けがしないな どの長所を有し、かつこれらの性能に加えて座榜 に関しても耐久性があるということから、眼鏡レ ンズ、カメラレンズ、双眼鏡用レンズ等の光学用 レンズはもとより、各種ディスプレイ、とくにC RT用ディスプレイ、およびその前面板などに好 ましく使用される。

[実施例]

以下に、実施例を挙げて更に詳細に説明するが、 本発明は、これらに限定されるものではない。

なお実施例中の部数は、重量部を表わす。

実施例1,2、比較例1

(1) コーティング用塗料の作成:

- 15 -

塗布し、次いで90℃、4時間加熱乾燥してコー ティングレンズを得た。

(3) 反射防止膜の作成

前記(2)によって得られたコーティングレンズの 上に無機物質の(ZrO2/TiO2/ Y2 O3)、Ta2 O5、 SiOzを真空蒸着法でこの順序にそれぞれ光学的膜 厚を λ / 4 (λ は 5 4 O nm) に設定して、レンズ の両面に多層被覆させた。

得られた反射防止プラスチック成形体の反射干 渉色はグリーンを呈し、全光線透過率は、98. 12%であった。

(4) 有機ケイ素化合物処理

ヘキサメチルジシラザンを底部に入れた容器の 中に前記(3)で得た反射防止膜を有するレンズを吊 り下げ、ヘキサメチルジシラザンの蒸気に16時 間暴露し、有機ケイ素化合物処理を行った(実施 例1)。また底部の溶液中に10分間浸渍して、 有機ケイ素化合物処理を行った(実施例2)。

(5) 性能評価

得られた光学物品の性能は、下記の方法に従っ - 17 -

アーグリシドキシプロピルメチルジエトキシシ ラン128.7部をピーカーに入れ、液温を10 ℃に保ちながらり、05規定塩酸水溶液18.7 部を少しずつ滴下し、加水分解を行った。滴下終 了後、この液にアークロロプロピルトリメトキシ シラン69.3部を加え、10℃に冷却しながら ・さらに、0.01規定塩酸水溶液18.9部を少 しずつ滴下し、シランの加水分解物を得た。滴下 終了後、この彼にメタノール分散シリカゾル(固 形分30%) 451. 6部、ジェチレングリコー ルジメチルエーテル34.4部、メチルアルコー ル263.8部、シリコーン系界面活性剤1.5 部、アセチルアセトンアルミニウム塩13.5部 を加え、充分投拌混合して塗料を得た。

(2) コーティングレンズの作成

ジエチレングリコールピスアリルカーポネート 重合体(CR-39)からなるレンズを先ずカセ イソーダの水溶液に浸漬したのち、良く水洗乾燥 し、上記(1)で作成したコーティング用組成物を引 き上げ速度10cm/分の条件でレンズ両面に浸漬

- 16 -

て試験を行った。なお、比較例として有機ケイ素 化合物処理をしないものについても試験した。結 果を第1表に示す。

(イ)水に対する静止接触角・

接触角計(協和界面科学(株)製品、CA-D 型)を使用し、室温下で、直径1.5mmの水滴を 針先に作り、これをレンズの凸面の最上部に触れ させて、液滴を作った。この時に生ずる液滴と面 との角度を測定し、静止接触角とした。

(口)外観

肉眼にて反射干渉色およびその均一性、濁りな どを観察した。

(ハ)反射防止性

全光線透過率(Ti)を測定し、下式によって 片面の表面反射率を求めて反射防止性を評価した。 反射防止性(表面反射率)=(100-Ti)/2

(二)耐汚染性試験

水道水5mlをレンズ凹面にしたたらせ、室温雰 囲気下で48時間放置後、布で拭いた時の水垢が 除去できた時を良好とし、除去できなかった時を

不良とした。

(ホ) 耐摩耗性試験

レンズ表面を人工汗液を染みこませた布で50 〇 g 荷重下で500回擦った後に、前記(イ)の 水に対する静止接触角を測定して、摩耗に耐する 耐久性試験を行った。

実施例3

(1) コーティング用塗料の作成

アーグリシドキシプロピルメチルジエトキシシラン75、9部、アーグリシドキシプロピルトリメトキシシラン25、1部をピーカーに入れ、液温を10℃に保ちなから0、05規定塩酸水溶液16、8部を少しずつ滴下し、加水分解を行った。滴下終了後、この液にメタノール分散シリカゾル(固形分30%)236、8部、メタノール131、4部、シリコン系界面活性削1、8部、アセチルアセトンアルミニウム塩4、3部を加え充分拇指混合して塗料を得た。

(2) コーティングレンズの作成

ジェチレングリコールビスアリルカーボネート
- 19 -

ルジシラザンの蒸気に30分間暴露し、有機ケイ 素化合物処理を行った。

(5) 性能評価

得られた光学物品の性能を実施例1と同様の方法で試験した。結果を第1表に示す。

実施例4

実施例1の有機ケイ素化合物処理において、有機ケイ素化合物を[R2SINH]n (n = 3が5Owt %、 n = 4が5Owt %、 R = Chb)の構造を有するサイクリックシラザンに代える以外はすべて実施例1と同様にした。結果を第1表に示す。

重合体(CR-39)からなるレンズをまずカセイソーダの水溶液に浸漬したのち、よく水洗乾燥し、上記(1)で作成したコーティング用組成物を引き上げ速度10cm/分の条件でレンズ両面に浸漬塗布し、次いで90℃、4時間加熱乾燥してコーティングレンズを得た。

(3) 反射防止膜の作成

前記(2)によって得られたコーティングレンズの上に無機物質の(ZrO2/TiO2/Y2O3)、Ta2O5、SiO2を真空蒸着法でこの順序にそれぞれ光学的膜厚を入/4(入は54Onn)に設定して、レンズの両面に多層被覆させた。

得られた反射防止プラスチック成形体の反射干 渉色はグリーンを呈し、全光線透過率は、98. 12%であった。

(4) 有機ケイ素化合物処理

メチルイソプチルケトン50部、ヘキサメチル ジシラザン50部からなる液を底部に入れた容器 の中に前記(3)で得た反射防止膜を有するレンズを 吊り下げ、メチルイソプチルケトン、ヘキサメチ

- 20 -

第1表

例Na	試験結果				
,	接触角	外観	反射防止性	耐汚染性	耐摩耗性
実施例1	97	良好	1.00	0	90
実施例2	80	良好	1. 00	0	7 2
実施例3	95	良好	1.00	0	71
実施例4	90	良好	1. 00	0	85
比較例1	19	良好	0. 94	Χ.	_

[発明の効果]

本発明により、以下のような効果を有する反射防止物品の製造方法を提供することができる。

- (1) 水垢などが付着し、乾燥されても容易に除去することが可能である。
- (2) 撥水性があるために、雨滴などが付いても容易に振り落とすことができる。
- (3) 摩耗に対する耐久性があり、眼鏡用レンズとしての使用性がよい。
- (4) 方法が簡単であるため、短時間で処理可能なことから、店頭などにおいても処理することができる。

特許出願人 東 レ 株 式 会 社

Old Mall Solk Con

THIS PAGE BLANK (0SPT0)